

表 5-5 ダイオキシン類に係る水質基準適用施設と水質排出基準

	特定施設の種類		排出基準
1	パルプ等製造業の漂白施設	硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）または亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素または塩素化合物による漂白施設	10pg-TEQ/ℓ
2	カーバイド法アセチレン製造業の洗浄施設	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	
3	硫酸カリウム製造業の廃ガス洗浄施設	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
4	アルミナ繊維製造業の廃ガス洗浄施設	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
5	担体付き触媒製造業の廃ガス洗浄施設*	担体付き触媒の製造の用に供する焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
6	塩化ビニルモノマー製造業の洗浄施設	塩化ビニルモノマー製造業の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	
7	カプロラクタム製造業の硫酸濃縮施設等	カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	
8	クロロベンゼン製造業の水洗施設等	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設	
9	フタル酸水素ナトリウム製造業のろ過施設等	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設	
10	ナフトキノン製造業のろ過施設等	2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設	
11	ジオキサジンバイオレット製造業の誘導体分離施設等	ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設	
12	アルミニウム・同合金製造業の廃ガス処理施設等	アルミニウムまたはその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉または乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
13	亜鉛回収業の精製施設等	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
14	担体付き触媒の金属回収に係るろ過施設等*	担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、排ガス洗浄施設	
15	廃棄物焼却炉の廃ガス処理施設等	大気に係る特定施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、および当該廃棄物焼却炉において発生する灰の貯留施設で汚水または廃液を排出するもの	
16	廃PCB等処理施設	廃棄物処理法により規定されている、廃PCB等またはPCB処理物の分解施設およびPCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設及び分離施設	
17	フロン類の破壊に係るプラズマ反応施設等*	フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
18	下水道終末処理施設	上記の1～17, 19に掲げる施設に係る汚水または廃液を含む下水を処理する施設	
19	工場・事業場からの排水処理施設	上記の1～13に掲げる施設を設置する工場・事業場から排出される水（上記の1～17に掲げる施設からの汚水または廃液を含むものに限る。）を処理する施設	

(注) * 平成17年9月1日から特定施設に追加

基準は、施行日から1年間適用猶予。ただし、既に当該工場または事業場が特定事業場（水質基準適用事業場）である場合は、施行日から基準適用。